⑷　軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの
ア　アルキルホスホニルジフルオリド（アルキル基の炭素数が３以下であるものに限り、メチルホスホニルジフルオリド（別名ＤＦ）を含む。）
イ　Ｏ－アルキル＝Ｏ－２－ジアルキルアミノエチル＝アルキルホスホニット（Ｏ－アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、Ｏ－アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、Ｏ－２－ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）又はそのアルキル化塩類若しくはプロトン化塩類（Ｏ－エチル＝Ｏ－２－ジイソプロピルアミノエチル＝メチルホスホニット（別名ＱＬ）を含む。）
ウ　Ｏ－２－ジアルキルアミノエチル＝ヒドロゲン＝アルキルホスホニット（Ｏ－２－ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）又はそのアルキル化塩類若しくはプロトン化塩類
エ　Ｏ－イソプロピル＝メチルホスホノクロリダート
オ　Ｏ－ピナコリル＝メチルホスホノクロリダート
カ　炭素数が３以下である１のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないリン原子を含む化合物
キ　Ｎ・Ｎ－ジアルキルホスホルアミジク＝ジハリド（アルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）
ク　ジアルキル＝Ｎ・Ｎ－ジアルキルホスホルアミダート（ジアルキル及びＮ・Ｎ－ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）
ケ　三塩化ヒ素
コ　２・２－ジフェニル－２－ヒドロキシ酢酸
サ　キヌクリジン－３－オール
シ　Ｎ・Ｎ－ジアルキルアミノエチル－２－クロリド（アルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）又はそのプロトン化塩類
ス　Ｎ・Ｎ－ジアルキルアミノエタン－２－オール（アルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）又はそのプロトン化塩類（Ｎ・Ｎ－ジメチルアミノエタノール及びＮ・Ｎ－ジエチルアミノエタノールを含む。）
セ　Ｎ・Ｎ－ジアルキルアミノエタン－２－チオール（アルキル基の炭素数が３以下であるものに限る。）又はそのプロトン化塩類
ソ　ビス（２－ヒドロキシエチル）スルフィド
タ　３・３－ジメチルブタン－２－オール
チ　塩化ホスホリル
ツ　三塩化リン
テ　五塩化リン
ト　亜リン酸トリメチル
ナ　亜リン酸トリエチル
ニ　亜リン酸ジメチル
ヌ　亜リン酸ジエチル
ネ　一塩化硫黄
ノ　二塩化硫黄
ハ　塩化チオニル
フ　エチルジエタノールアミン
ヘ　メチルジエタノールアミン
ホ　トリエタノールアミン
⑸　化学兵器による汚染の除去に適した化学製剤であるジエチレントリアミン
⑹　神経剤が引き起こす症状を予防する化学製剤であって、次のいずれかに該当するもの
ア　ブチリルコリンエステラーゼ
イ　臭化ピリドスチグミン
ウ　塩化オビドキシム
２　軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの（別表第１に掲げるものを除く。）
⑴　反応器であって、容量が0.1立方メートル超20立方メートル未満のもののうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
ア　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
イ　ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
ウ　フッ素樹脂
エ　ガラス
オ　タンタル又はタンタル合金
カ　チタン又はチタン合金
キ　ジルコニウム又はジルコニウム合金
⑵　貯蔵容器であって、容量が0.1立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの
ア　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
イ　ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
ウ　フッ素樹脂
エ　ガラス
オ　タンタル又はタンタル合金
カ　チタン又はチタン合金
キ　ジルコニウム又はジルコニウム合金
⑶　熱交換器又は凝縮器であって、伝熱面積が20平方メートル未満のもののうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、若しくは被覆されたもの又はこれらの部分品
ア　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
イ　ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
ウ　フッ素樹脂
エ　ガラス
オ　黒鉛又はカーボングラファイト
カ　タンタル又はタンタル合金
キ　チタン又はチタン合金
ク　ジルコニウム又はジルコニウム合金
ケ　炭化けい素
コ　炭化チタン
⑷　蒸留塔又は吸収塔であって、塔の断面積が0.00785平方メートルを超えるもののうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、若しくは被覆されたもの又はこれらの部分品
ア　ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の40パーセントを超える合金
イ　ニッケルの含有量が全重量の25パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の20パーセントを超える合金
ウ　フッ素樹脂
エ　ガラス